



## 報道発表

2018年9月4日

報道関係各位

### 本埠秀昭氏が株式会社 D2S の代表取締役社長に就任 －日本での開発力強化と事業連携を加速－

半導体フォトマスク製造の為にマスクデータ処理(MDP)ソフトウェアやフォトマスク製造技術並びにウエハリソグラフィ技術に関連するソフトウェア製品群をGPU(グラフィカルプロセッシングユニット)ベースのプラットフォームと共に提供するシリコンバレー企業である D2S, Inc. (本社: 米国カリフォルニア州サンノゼ市、以下 D2S 社) は、9月1日付けで本埠秀昭氏が日本の同社小会社、株式会社 D2S の代表取締役社長に就任したことを本日発表しました。本埠秀昭氏は半導体レイアウト設計用 EDA ツール開発に長年従事し、2002年に設立された TOOL 株式会社にて設立当初から 2014年まで、代表取締役社長として、高速レイアウトビューア、フラクチャリングシステムなどの製品の事業化を行い併せて、米国法人、台湾法人を立ち上げると共にワールドワイドな代理店網を構築し、全世界的なビジネス展開をするなど経営者としての豊富な経験と実績を有しております。現在も複数のベンチャー企業の役員としても活躍しています。

D2S 社では氏のこれらの経験を活かして、日本の子会社での開発力の強化とタイムリーな製品化へのより一層の寄与を目指した、日本が世界に誇る半導体フォトマスクメーカーやフォトマスク関連装置メーカーとの関係を発展させる事を加速させたいと考えています。

D2S 社はパターンが複雑化するマスクの製造に対し、既存 eBeam (電子ビーム) 技術を最大限に活用して、より高精度に、かつ、現実的な描画時間でマスク製造を可能とする TrueMask® MDP や、マスク製造における多様な解析要求に応える TrueMask® DS などの製品を、業界に先駆けて開発した GPU+CPU プラットフォームと共に提供しています。また、新しい eBeam 技術である MB Mask (マルチビームマスク) 露光技術に対応する技術並びに製品を提供しています。

#### 本埠秀昭氏の略歴

- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 1980年4月～ | 株式会社ツール社入社<br>半導体レイアウト設計ツール開発       |
| 2002年4月～ | TOOL 株式会社代表取締役社長<br>自社製品の事業化、W/W 展開 |
| 2014年3月  | TOOL 株式会社役員退任                       |

-more-

藤村 晶 (Aki Fujimura) 氏 (D2S, Inc. Chairman 兼 CEO)

「日本の半導体設計製造業界の著名人である本埜秀昭氏を D2S 社に迎えることができ大変嬉しく思います。本埜氏の革新的な EDA ツールの開発や事業展開の実績と経験を基に、当社の Model-based MDP 製品である TrueMask MDP のマスク製造前工程への適用や高速・高精度露光シミュレーション機能を持つ TrueMask DS の各種マスク検査装置との連携とマスク製造後工程への適用など、当社が現在進めております製品開発と事業連携を、氏が参加する事でさらに強力に押し進めて行けると期待しております」

本埜秀昭氏 (株式会社 D2S 代表取締役社長)

「ナノメートルオーダーの最先端半導体の製造が実現されるに従い、大きく減少したプロセスマージンの問題への的確な対処が求められるようになっております。そのため、複雑なマスクパターンを高精度にかつ安定的に形成する技術の必要性はますます増大しており、TrueMask MDP や TrueMask DS など D2S 社の持つ数々の先端ソリューションはこの要求に的確に応えるものと確信しております。今回 D2S 社の経営チームに参加することで、皆様の課題解決に大いに寄与したいと考えております」

#### D2S 社について：

D2S 社は既存 eBeam 技術を最大限に活用し、少量生産および大量生産に対するマスク製造コストを削減するための GPU+CPU を核としたコンピュータベースの設計プラットフォームを提供する企業です。D2S TrueMask® ソリューションは、高品質デバイス実現のために必要とされる複雑なフォトマスク形状を、既存の eBeam マスク描画装置を利用し、経済的に許容される描画時間で、28nm あるいはそれ以降の世代の先端フォトマスクの製造を可能とする製品です。

更に、次世代フォトマスク露光装置である MB Mask Writer (マルチビームマスク描画装置) の能力を最大限に発揮させることが出来るマスクデータ処理ソフトウェアを GPU+CPU アーキテクチャのプラットフォームと共に提供を開始しています。詳細につきましては、：[www.design2silicon.com](http://www.design2silicon.com) をご参照ください。

本件に関するお問い合わせ先：

株式会社 D2S

田中喜男 (取締役)

Tel: 045-479-8390 (代)

E-mail: [info@design2silicon.com](mailto:info@design2silicon.com)

*D2S と TrueMask は、D2S, Inc. の登録商標です。D2S のロゴは商標登録中です。本報道発表内で提供されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。*